

【発明の名称】 基板洗浄機、基板洗浄装置、洗浄済基板の製造方法及び基板処理装置

清浄な洗浄部材で洗浄しつつスループットを向上させることができる基板洗浄機、基板洗浄装置、洗浄済基板の製造方法及び基板処理装置を提供する。

基板洗浄機 1 は、基板 W を保持する基板保持装置 10 と、基板保持装置 10 に保持された基板 W の第 1 の面 W A に接触させて第 1 の面 W A を洗浄する第 1 の洗浄部材 11 a を有する第 1 の洗浄装置 11 と、基板保持装置 10 に保持された基板 W の第 1 の面 W A に接触させて第 1 の面 W A を洗浄する第 2 の洗浄部材 12 a を有する第 2 の洗浄装置 12 と、第 1 の洗浄部材 11 a 及び第 2 の洗浄部材 12 a の、一方が基板保持装置 10 に保持された基板 W の第 1 の面 W A を洗浄しているときに、他方が基板保持装置 10 に保持された基板 W から離れた位置にあるように、第 1 の洗浄装置 11 及び第 2 の洗浄装置 12 を制御する制御装置 50 とを備える。

Figure 1